

in-situ 偏向全反射蛍光XAFS装置

In-situ Polarized Light Total Reflection Fluorescent XAFS Instrument

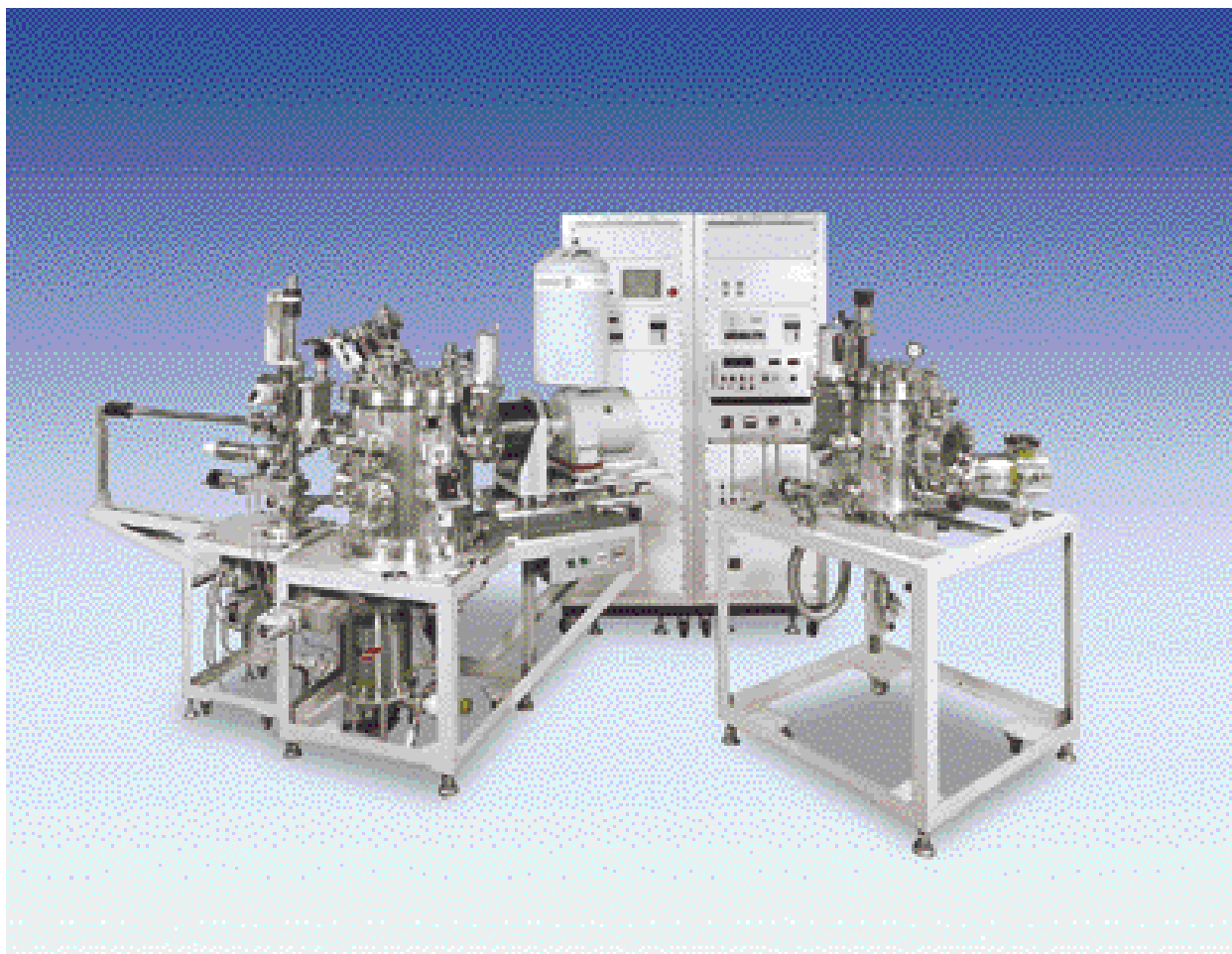
PAT.

概要

Outline

本装置はシンクロトロン放射光のX線を使用し、触媒活性点など表面に高分散した化学種をin-situ条件下で三次元的に構造解析ができる表面構造解析装置です。また、長距離秩序を必要としない局所構造解析が可能です。

This device is used for three-dimensional structural analysis of chemical species such as catalytic activation spots that are highly dispersed on a surface, using synchrotron radiation X-rays under in-situ conditions. This device is for surface structure analysis and can be used for local structural analysis that does not require long-distance regularity.



納入先 東京大学

Actual installation : The University of Tokyo

A1 真空用ミニコンピュータ

A2 真空ファンジ

A3 真空用ボルト・ナット

A4 真空装置

A5 その他アクセサリ

B 分析機器

C 受託業務

D 加速器・放射光利用機器

E オーダーメイド製品